

## 第 172 回微小光学研究会

### 「半導体：光がささえる最先端技術」

日本を取り巻く半導体技術の進展は時々刻々と変化していく中，光技術がいかに半導体産業の持続的な発展に貢献してゆくのかが，現場の技術者でも全体像の把握は困難だったかと推測します．本研究学会プログラムでは近年の積極的な半導体戦略に至る背景を解説するほか，技術面では光源からはじまり，光材料，ステルスダイシング，光実装などへ至るまで，日本の強みである"光"を活用した半導体技術の源泉を明らかにすることを目的とします．半導体素子の性能向上，製造工程の効率化，そして新たな応用開拓に向けた活発な議論を期待すると共に，光が支えていく未来の半導体産業を探索していきます．

日時：2024年9月5日（木）13:00～17:30

会場：産業技術総合研究所 臨海副都心センター

別館 11F 第 1-3 会議室

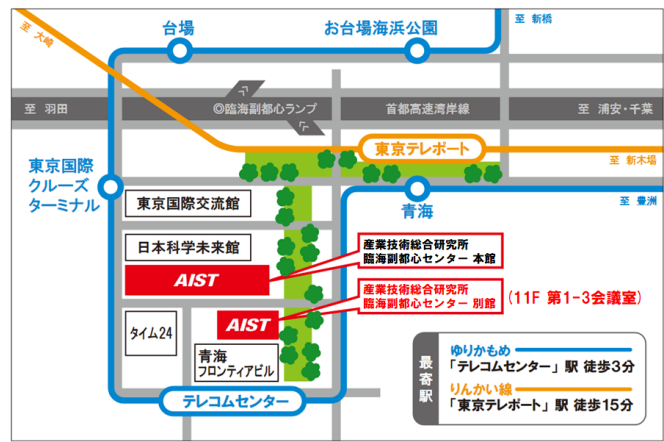
〒135-0064 東京都江東区青海 2 丁目 4-7

<https://www.aist.go.jp/waterfront/ja/access/>

※オンライン同時開催予定

交通：ゆりかもめ「テレコムセンター」駅下車 徒歩 3 分

りんかい線「東京テレポート」駅下車 徒歩 15 分



#### プログラム案

13:00～13:10 開会の挨拶

13:10～13:50 (基調講演) 半導体・デジタル産業戦略

小林 健 (経済産業省)

13:50～14:30 (特別講演) 半導体製造用 EUV/DUV 光源開発の現状

溝口 計 (九州大学)

14:30～15:00 EUV レジスト開発の最新動向

藤森 亨 (富士フイルム)

15:00～15:20 《休憩》

15:20～15:50 EUV マスクブランクス欠陥検査装置

渡辺 諒，井手 智朗，佐久間 翔平，鈴木 智博 (レーザーテック)

15:50～16:20 半導体パッケージの大サイズ化および微細化要求に適應するマスクレス露光装置

乗光 良直 (SCREEN セミコンダクターソリューションズ)

16:20～16:50 ステルスダイシングの最新動向

新村 拓人 (浜松ホトニクス)

16:50～17:20 熊本大学における半導体人材育成への取り組み

青柳 昌宏 (熊本大学)

17:20～17:30 閉会の挨拶 (※閉会後に講師との交流会を計画中です)

参加費 (消費税込，予稿集代を含む)：一般 5,000 円，応用物理学会員 4,000 円

学生・シニア 2,000 円，学生・シニアの応用物理学会員 1,000 円

参加申込：要事前申込，<https://www.comemoc.com/meeting/mo172.htm> よりお申込下さい

(開催日の数日前に予稿集と請求書を郵送致しますので，参加費 (予稿集代を含む) をお支払いください)

問合せ先：高 磊 (rai.kou-takahashi ■ aist.go.jp) (■を@に換えてください)

微小光学研究会 代表：伊賀 健一 運営委員長：中島 啓幾 実行委員長：横森 清

運営副委員長：波多腰 玄一 実行副委員長：宮本 智之

担当委員：森 伸芳(山下電装)，片山 龍一(福岡工大)，宮本 智之(東工大)，佐藤 具就(NTT)，高 磊(産総研)

※プログラムは微小光学研究会のウェブサイト <https://www.comemoc.com/> でもご覧いただけます

※オンライン同時開催予定です．現地会場における聴講は先着順のため，会場の定員に達する場合はオンライン聴講となりますのでご了承下さい